

## 高真空蒸着装置 ED-1250R



高真空蒸着装置ED-1250Rは小型蒸着装置の全機構搭載型装置です。研究機構向けに開発された本装置は、抵抗加熱機構2対・電子銃・基板回転機構・基板加熱機構を搭載しており、排気系もターボ分子ポンプを採用しておりますので、短時間で高真空排気が可能です。真空槽はガラスベルジャーとなっておりますので、内部の観察が容易に出来ます。2インチウエハー程度の成膜であれば本装置で十分に可能です。本装置は低予算、小スペース化を実現しておりますので、一度ご相談下さい。

### 高真空蒸着装置 ED-1250R 仕様

- 到達圧力 2.0×10<sup>-4</sup>Pa以下※ワーク挿入時・常温時
- 排気速度 6.7×10<sup>-3</sup>Pa迄本引開始後10分以内※ワーク挿入時・常温時
- 真空漏洩量 1.2×10<sup>-10</sup>Pa・m<sup>3</sup>/sec Heリークデテクター検査
- 真空室径 φ230mm×240mmH 硬質ガラス
- 蒸着機構 抵抗加熱方式2対(ポート)  
AC10V0~50A  
制御方式:サイリスタ制御  
電流計・可変ボリューム  
電子銃:ルツボ1点 加速電圧:-4kV 最大電流値:750mA  
電子銃操作用電源
- 基板形状 □10~15mm 4枚
- 基板回転 3インチ回転基板台  
基板回転数:0~5rpm  
モーターコントローラ
- 基板加熱 インコネル製ヒーター(ヒーター板:透明石英板)  
常温~450℃迄昇温可能  
ヒーター制御:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 真空排気系 油回転ポンプ:333L/min[50Hz]  
ターボ分子ポンプ:300L/sec(N<sub>2</sub>)
- 真空計 ピラニ真空計/電離真空計
- 操作方法 手動
- 制御系 ターボ分子ポンプパワーサプライ
- ユーティリティ 電気:AC200V三相4kVA/AC100V単相30A  
冷却水:3L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環  
寸法:1350mmW×1220mmD×1230mmH